

平成 22 年 7 月 6 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 123 回研究会 開催通知

日時： 2010 年 7 月 23 日 (金) 13:00 ～ 17:00
会場： 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン 2 階 A1 会議室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 日本学術振興会学術創成研究「シリコン CMOS フォトニクス」成果発表会

世話人：和田一実(東大)

プログラム

- 13:00～13:10 開会の挨拶 田島道夫(JAXA)
- 13:10～13:40 学術創成研究報告「シリコン CMOS フォトニクス」和田一実 (東大)
- 13:40～14:00 「145 委員会タスクフォースの研究活動」
副題「シリコンリング共振器の発光と水素処理」山下善文 (岡山大)
- 14:00～14:20 「145 委員会タスクフォースの研究活動」
副題「微小 Ge 領域の X 線解析評価」石川靖彦 (東大)
- 14:20～14:50 「Ge 受光器のモノリシック形成」
副題「東大と NTT の共同研究」板橋聖一 (NTT マイクロシステムインテグレーション研究所)
- 14:50～15:20 休憩
- 15:20～15:50 「MIRAI における LSI 光配線研究」大橋啓之 (NEC グリーンイノベーション研究所)
- 15:50～16:20 「第一原理計算によるシリコン量子井戸発光素子の研究」諏訪雄二、斎藤慎一、
(日立製作所基礎研究所)
- 16:20～16:50 「超低損傷・中性粒子ビーム加工を用いた量子ナノ構造の形成」寒川誠二 (東北大学)
- 16:50～17:00 閉会の辞 梅野正隆(福井大学)
- 17:00～ 懇親会 (場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階 サロン燦)

以上